

**V2009 Industrieausstellung & Workshop-Woche
Vakuumbeschichtung und Plasmaoberflächentechnik
21.–22. Oktober 2009 im RAMADA Hotel Dresden**

Workshop: Beschichtungen für den optischen Gerätebau

Mittwoch, 21. Oktober 2009

- 14:00 Uhr *Anforderungen an optische Schichten: Stand der Technik in der Produktion*
H. Pulker, Universität Innsbruck, Innsbruck
- 14:20 Uhr *Die Rolle des Plasmas bei der Optikbeschichtung*
N. Kaiser, Fraunhofer IOF, Jena
- 14:40 Uhr *Schichtstrukturen plasmagestützter Beschichtungsprozesse - Nanoskopische Einblicke*
J. Ebert, W. Ebert, Laseroptik GmbH, Garbsen
- 15:00 Uhr *Breitband-Entspiegelung von Glas- und Kunststoffoptik*
U. Schulz, Fraunhofer IOF, Jena
- 15:20 Uhr *Kaffeepause*
- 15:50 Uhr *Beschichtungen für die EUV-Lithografie*
M. Perske, H. Pauer, T. Feigl, S. Yulin, Fraunhofer IOF, Jena
- 16:10 Uhr *Einstieg ins Optische Monitoring: ein Erfahrungsbericht*
J. Terhürne, bte Bedampfungstechnik GmbH, Elsoff
- 16:30 Uhr *Helios und optisches Monitoring*
M. Scherer, A. Zöller, Leybold Optics GmbH, Alzenau
- 16:50 Uhr *Virtuelle Beschichtungsläufe zur Design- und Prozessführungsoptimierung*
St. Wilbrandt, Fraunhofer IOF, Jena
- 17:10 Uhr *Oxidische nanoporöse Schichten mit ausbalancierten optischen und mechanischen Eigenschaften*
O. Stenzel, Fraunhofer IOF, Jena

Donnerstag, 22. Oktober 2009

- 08:30 Uhr *Optische Eigenschaften mikro- und nanostrukturierter Kunststoffoberflächen*
H. Lauth, Fresnel Optics GmbH, Apolda
- 08:50 Uhr *Feinoptik auf Metall, Kunststoff, Glas - ein Terzett für industrielle Serienbauteile*
O. Treichel, S1 Optics GmbH, Nürtingen
- 09:10 Uhr *Abscheidung von anorganischen und Hybridschichten für optische Anwendungen mittels Magnetronspütern und Magnetron-PECVD*
P. Frach, D. Glöß, H. Bartzsch, K. Täschner, J. Liebig, E. Schultheiß
- 09:30 Uhr *Beschichtung von Kunststoffen in der Serienfertigung*
S. Gaumitz, T. Bauer, JENOPTIK Polymer Systems GmbH, Triptis
- 9:50 Uhr *Herstellung organischer LED für optoelektronische Anwendungen*
K. Fehse, Ch. May, Fraunhofer IPMS, Dresden
- 10:10 Uhr *Kaffeepause*
- 10:40 Uhr *Fortschritte bei Plasma-Ionen gestützten Beschichtungsprozessen*
H. Hagedorn, Leybold Optics GmbH, Alzenau

- 11:00 Uhr *Strukturierbare optische Schichten auf der Basis von Chrom*
M. Schürmann, W. Stöckl, N. Kaiser, Fraunhofer IOF, Jena
- 11:20 Uhr *Innovative Bearbeitungs- und Beschichtungsverfahren für Optiken im kurzwelligen Bereich*
A. Leson, S. Braun, P. Gawlitza, M. Menzel, Fraunhofer IWS, Dresden
- 11:40 Uhr *Hochleistungs-Beschichtungen für die Laserentwicklung und Messtechnik*
St. Günster, Laser Zentrum Hannover e.V., Hannover
- 12:00 Uhr *Selbstblockende, rein-dielektrische NIR-Bandpassfilter für die Fernerkundung der Erde*
U. Schallenberg, mso jena Mikroschichtoptik GmbH, Jena
- 12:20 Uhr *Mittagspause*
- 13:30 Uhr *Neue Entwicklungen in der Magnetron-Sputtertechnik für optische Schichten: Hochionisierte Plasmen et al.*
M. Vergöhl, Fraunhofer IST, Braunschweig
- 13:50 Uhr *Strukturierte optische Filterbeschichtungen*
O. Züger, Optics Balzers AG, Balzers
- 14:10 Uhr *Dielektrische Targetmaterialien (Mischtargets) in Magnetron Sputtertechnologien für optische Dünnschichtsysteme: Prozesstechnologie, Schichteigenschaften, Nb₂O₅, Ta₂O₅*
G. Strauss, St. Schlichtherle, PhysTech Coating Technology GmbH, Pflach
- 14:40 Uhr *Ultra-precise Ion Beam Figuring (IBF) of optical Devices*
E. Loos, ROTH & RAU AG
- 15:10 Uhr *RF-Plasmaunterstützte Aufdampfen mittels Taurion-Anlage*
W. Schwärzler, PROVAC AG, Balzers